플라즈마열분해된 지르콘으로부터의 이산화규소침출에 미치는 몇가지 인자들이 영향

장광남, 우영남, 안명진

경애하는 최고령도자 김정은동지께서는 다음과 같이 말씀하시였다.

《정보기술, 나노기술, 생물공학을 비롯한 핵심기초기술과 새 재료기술, 새 에네르기기술, 우주기술, 핵기술과 같은 중심적이고 견인력이 강한 과학기술분야를 주라격방향으로 정하고 힘을 집중하여야 합니다.》(《조선로동당 제7차대회에서 한 중앙위원회사업총화보고》 단행본 39폐지)

이산화지르코니움(${\rm ZrO_2}$)과 지르코니움염들은 금속공업과 도자기공업, 전자공업을 비롯한 인민경제 여러 분야에서 다양한 목적으로 리용되고있는 가치있는 재료이다.[2] ${\rm ZrO_2}$ 은 플라즈마열분해된 지르콘[1]에서 이산화규소(${\rm SiO_2}$)를 침출시켜 제거하는 방법으로 제조할수 있다.

론문에서는 NaOH용액에 의한 플라즈마열분해된 지르콘으로부터의 SiO₂ 침출에 미치는 몇가지 인자들의 영향을 고찰하고 합리적인 침출조건을 론의하였다.

실험원리 및 방법

플라즈마열분해된 지르쿈 $(ZrO_2 \cdot SiO_2)$ 으로부터의 SiO_2 침출반응은 다음과 같다.[3, 4] $ZrO_2 \cdot SiO_2 + 2NaOH = Na_2SiO_3 + ZrO_2 + H_2O$

이 반응에 의한 ${
m SiO}_2$ 의 침출률은 NaOH용액의 농도와 고액비, 침출시간과 온도, 침출계의 압력에 의존한다.

실험에서는 환류랭각기가 설치된 침출조에 10g의 플라즈마열분해된 지르콘시료와 NaOH용액을 일정한 고액비로 넣고 혼합한 다음 주어진 온도와 대기압조건에서 일정한 시간동안 교반하는 방법으로 SiO_2 을 침출시켰다. 그리고 침출액을 방온도까지 랭각시킨 다음 상등액을 분리하고 찌끼로 남은 ZrO_2 을 세척액의 pH가 7로 될 때까지 탈이온수로 충분히 세척하였다.

 SiO_2 침출률 $(\eta/\%)$ 은 다음식으로 결정하였다.

$$\eta = \frac{\text{침출된 SiO}_2 의 질량}{\text{SiO}_2 의 초기질량} \times 100$$

불산과 류산의 혼합액(체적비 10:1)이 들어있는 지르코니아도가니에 적당한 량의 플라즈마열분해된 지르콘시료를 넣고 류산지르코니움의 흰색흐림이 생기기 시작할 때까지 가열한 다음 700∼800℃의 마플로에서 30min동안 작열하고 저울질하여 결정한 질량차는 SiO₂의 초기질량에 해당된다. 한편 플라즈마열분해된 지르콘시료와 침출후 남은 ZrO₂의 질량차는 침출된 SiO₂의 질량에 해당된다.

실험결과 및 해석

침출률에 미치는 NaOH농도와 침출시간의 영향 NaOH농도와 침출시간에 따르는 ${
m SiO_2}$ 침출 률은 표 1과 같다.

표 1. NaOH농도와 침출시간에 따르는 SiO_2 침출률(%)

NaOH농도/% -	침출시간/h						
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5		
30	15.3	36.5	48.7	57.3	63.7		
40	19.7	41.7	52.2	61.4	68.0		
50	35.6	63.2	84.7	100	100		

고액비 1:2, 침출온도 25℃

표 1에서 보는바와 같이 NaOH농도가 50%일 때 2h동안 침출하면 SiO_2 을 100% 침출시킬수 있다.

침출률에 미치는 고액비의 영향 고액비에 따르는 SiO₂침출률은 표 2와 같다.

표 2. 고액비에 따르는 SiO₂ 침출률(%)

고액비	1:0.76	1:0.92	1:1.08	1:1.22	1:1.37	1:1.53
침출률/%	27.3	40.3	55.0	74.0	95.0	100

NaOH농도 50%, 침출온도 25℃, 침출시간 2h

표 2에서 보는바와 같이 NaOH농도 50%, 침출온도 25℃, 침출시간 2h일 때 고액비를 1:1.53으로 보장하면 SiO₂을 100% 침출시킬수 있다.

침출률에 미치는 침출온도의 영향 침출온도에 따르는 SiO₂침출률은 표 3과 같다.

표 3. 침출온도에 따르는 SiO₂ 침출률(%)

침출온도/℃	110	120	130	143
침출률/%	29.9	39.5	59.7	100

NaOH농도 50%, 고액비 1:1.53, 침출시간 2h

50% NaOH용액의 끓음점은 143℃이다. 그러므로 표 3으로부터 끓는 NaOH용액으로 침출할 때 SiO₂ 침출률이 100%로서 가장 높다는것을 알수 있다.

한편 X선형광분석결과에 의하면 얻어진 ZrO2의 순도는 99%이다.

맺 는 말

NaOH용액에 의한 플라즈마열분해된 지르콘으로부터의 SiO_2 침출에 미치는 몇가지 인 자들의 영향을 고찰하였다.

플라즈마열분해된 지르콘과 50% NaOH용액을 1:1.53의 고액비로 혼합하고 143℃의 온도와 대기압조건에서 2h동안 침출하면 SiO₂을 100% 제거할수 있으며 얻어진 ZrO₂의 순도는 99%이다.

참 고 문 헌

- [1] 김일성종합대학학보(자연과학), 63, 4, 84, 주체106(2017).
- [2] 장광남 등; 조선민주주의인민공화국 과학원통보, 2, 57, 주체104(2015).
- [3] W. Lowrence et al.; USP 3749763, 1973.
- [4] Alexander Fridman; Plasma Chemistry, Cambridge Univercity Press, 477~479, 2008.

주체107(2018)년 1월 5일 원고접수

Influence of Some Factors on Leaching of Silicon Dioxide from Zircon Decomposed in Thermal Plasma

Jang Kwang Nam, U Yong Nam and An Myong Jin

We considered the influence of some factors on leaching of silicon dioxide from zircon decomposed in thermal plasma by 50% sodium hydroxide solution.

When the mixture with ratio of solid to liquid of 1:1.53 is leached for 2 hours under the conditions of the temperature of 143°C and the atmospheric pressure, it is possible to remove silicon dioxide completely. Then the purity of zirconium dioxide obtained is 99%.

Key words: zircon, silicon dioxide